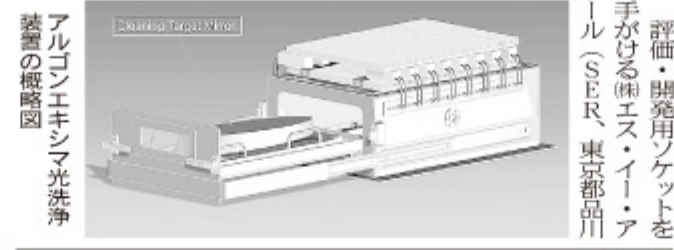


# SEI EUV向けに新事業 集光ミラーの洗浄装置



アルゴンエキシマ光洗浄装置の構造図

詳細・開発用ソケットを手がける株式会社エス・イー・アール(S・E・R、東京都品川区北品川1-14-8、電話3-5796-0333)は、次世代露光技術のEUVリソグラフィ向けに新事業を開始する。同社は、(横浜市)から技術提供を受け、アルゴン(Ar)エキシマ照射光源を用いた洗浄装置の販売を開始した。SEIは半導体用ソケットを中心に事業を展開するが、今回NTTから露光装置分野に本格進出する。NTTは2001年設立の宮崎大学発のベンチャー企業。同大学教授の佐々木直氏の成果をもとに、露光装置プロジェクトの一環としてリソグラフィ装置やEUVマ

スクリーン検査装置が用いられるが、その装置内で使用される集光ミラーの反射面汚れの問題が顕在化している。反射面汚染は、装置のダウンタイム増加や精度劣化の主要因として問題とされてきた。同装置の特徴であるドラッグ・オフによるソフト洗浄工程を用いる。汚染された鏡面を初期状態に戻元することができ、EUVリソグラフィは長らく次世代露光技術の有力候補位置づけられていたが、光源の出力不足やマスク・プロセスの欠陥検出技術の確立などに技術的問題を抱え、露光導入が先送りされてきた。しかし、近年は問題が徐々に解決され、主要な半導体メーカーを中心に最先端プロセスへの導入を決めることが出ている。

SEIは、このArエキシマ光洗浄装置をEUVリソグラフィ向けに積極的に展開していく。EUVリソグラフィでは、リソグラフィ装置やEUVマ